

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成26年8月14日(2014.8.14)

【公開番号】特開2012-30592(P2012-30592A)

【公開日】平成24年2月16日(2012.2.16)

【年通号数】公開・登録公報2012-007

【出願番号】特願2011-149156(P2011-149156)

【国際特許分類】

B 3 2 B 5/18 (2006.01)

C 0 1 B 33/12 (2006.01)

B 3 2 B 9/00 (2006.01)

C 0 8 J 7/06 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 5/18

C 0 1 B 33/12 C

B 3 2 B 9/00 A

C 0 8 J 7/06 C E R Z

C 0 8 J 7/06 C E Z

【手続補正書】

【提出日】平成26年7月1日(2014.7.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

T gが200℃以下の透光性基材上に多孔質シリカ膜を有する積層体の製造方法であって、アルコキシシラン化合物、水、有機溶媒、および有機ポリマーを含む組成物をT gが200℃以下の透光性基材上に湿式塗布した後、酸または、塩基と接触させ、前記有機ポリマーを抽出する工程を含むことを特徴とする多孔質シリカ膜を有する積層体の製造方法。

【請求項2】

該酸または、塩基が、塩化水素、ぎ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、アンモニア、メチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、アチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、n-プロピルアミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、シクロペンチルアミン、シクロヘキシルアミンから選ばれる少なくとも一つである請求項1記載の積層体の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

本発明の第1の要旨は、T gが200℃以下の透光性基材上に多孔質シリカ膜を有する積層体の製造方法であって、アルコキシシラン化合物、水、有機溶媒、および有機ポリマーを含む組成物をT gが200℃以下の透光性基材上に湿式塗布した後、酸または、塩基と接触させ、前記有機ポリマーを抽出する工程を含むことを特徴とする多孔質シリカ膜を有する積層体の製造方法に存する（請求項1）。